

施設共用におけるALD成膜の ユーザー事例紹介

物質・材料研究機構、東京科学大学、北海道大学、産業技術総合研究所は、令和3年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ事業 (ARIM)」の一環として、『施設共用におけるALD成膜のユーザー事例紹介』というオンラインセミナーを2025年8月6日(水)にTeams配信により開催いたします。ARIM共用事業では、これまでの施設利用に加えて利用結果のデータベース化とそれらのデータの利活用が大きな事業目標となっています。今回は、これまでの様々なALD成膜事例についてユーザー様からご紹介いただきます。また、データベースの閲覧環境が整いつつありますので、その閲覧方法やデータカタログの一部を紹介いたします。

◇概要

【日時】令和7年8月6日(水)12:55~17:00

【Teamsによるオンライン配信】 URLは、開催日までに連絡します

【参加費】無料

【定員】200名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内/申し込み】 <https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2025-1/>

【問い合わせ】 tia-npf-school1@aist.go.jp

◇講演プログラム

- | | | | |
|-------------|--|---------------------------------------|------|
| 12:55-13:00 | はじめに | 産総研ナノプロセッシング施設運営室 | 松本壮平 |
| 13:00-13:20 | 北海道大学共用施設紹介 | 北海道大学総合イノベーション創発機構
ナノテクノロジー連携研究推進室 | 松尾保孝 |
| 13:20-13:40 | 湿式法とALDの融合に基づく酸化ニッケル膜(NiO_x)の作製:
光学・電気化学デバイスへの展開 | 東北大学多元物質科学研究所 | 押切友也 |
| 13:40-13:50 | 産総研ナノプロセッシング施設(NPF)のALD実験環境 | 産総研ナノプロセッシング施設運営室 | 山崎将嗣 |
| 13:50-14:10 | ALD酸化チタン(TiO_x)を用いた新型結晶シリコン太陽電池の開発と界面評価 | 産総研 再生可能エネルギー研究センター | 松井卓矢 |
- (裏面へ続く)

◇講演プログラム(続き)

- 14:10-14:30 アミノシラン原料によるALD法によるSiO₂の成膜特性
メルクエレクトロニクス株式会社 小林明子
- 14:30-14:50 Cp、アミン系Zr源を使ったZrO₂膜のALD成膜と評価
株式会社トリケミカル研究所 今瀬章公
- 14:50-15:05 休憩
- 15:05-15:25 プラズマALDを用いる後工程トランジスタ向け薄膜酸化インジウム(InO_x)チャンネルFETs
産総研 先端半導体研究センター Chia-Tsong Chen
- 15:25-15:45 GaCp*を用いた結晶性GaN膜の原子層堆積
株式会社高純度化学研究所 先端材料研究部 水谷文一
- 15:45-16:05 ALDで成膜したRu膜のin-situ XPS測定
産総研 先端半導体研究センター 浅沼周太郎
- 16:05-16:25 SiO₂膜質に対するピュアオゾンガスとプリカーサーの関係
株式会社明電舎先進技術研究所マテリアルシステム研究部 亀田直人
- 16:25-16:40 ARIMデータポータルを用いたALD成膜データの利活用
産総研ナノプロセッシング施設運営室 相浦義弘
- 16:40-16:50 NIMS-ARIM微細加工施設紹介
NIMS 技術開発・共用部門 微細加工ユニット 津谷大樹
- 16:50-17:00 東京科学大共用施設紹介とALD活用例
東京科学大学 工学院 宮本恭幸

主催:産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設(NPF)

主催:物質・材料研究機構 ARIMセンターハブ担当領域推進室

主催:東京科学大学ナノ構造造形支援事業

主催:北海道大学総合イノベーション創発機構 ナノテクノロジー連携研究推進室

お問い合わせ:tia-npf-school1@aist.go.jp